مجله علوم و فنون هسته ای، جلد ۹۹، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱



Journal of Nuclear Science and Technology Vol. 99, No. 2, 2022

مقایسه فرایند پشتنگاری لیزری در زیرلایههای شفاف شیشه و کوارتز

شبنم عباسی'، داود رزاقی'، هدیه پازکیان*'

۱. گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، کد پستی: ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴، تهران – ایران ۲. پژوهشکده فوتونیک و فنآوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: ۸۳۶–۱۴۳۹۵، تهران – ایران Email: hpazokian@aeoi.org.ir*

مقالەي پژوھشى

تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۸/۱۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۱۰/۱۶

چکیدہ

كليدواژەھا: پشتنگارى ليزرى، كندگى ليزرى، پلاسمون، ميكروكانال

Comparison of the laser backwriting process on glass and quartz

Sh. Abbasi¹, D. Razaghi², H. Pazokian^{*2}

1. Physics Department, Iran University of Science and Technology, Postal code: 1684613114 ,Tehran - Iran 2. Photonic and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14395-836, Tehran - Iran

Research Article

Received 31.10.2020, Accepted 5.1.2021

Abstract

The laser back writing process (LBW) on the glass and quartz has been studied in the present work. For this purpose, a steel target was irradiated with Q-switched Nd:YAG laser pulses. As a consequence of the laser irradiation, the produced plasma is penetrated onto the glass and quartz substrates. The process was compared for two different samples. The effects of the pulse numbers and the laser fluence on the morphology and the target material penetration on the substrate were investigated. The results show that this process produces microchannels with the controlled dimensions (the depth and width) on the substrate. The presence of the nanoparticles (Fe and Cr ions on quartz and Fe ions on glass) is an important result of this process that can affect the microchannels' function. Irradiation parameters, including the number of pulses, the laser fluence, the pulse repetition rate, and the substrate material, affect the channel quality and the type and rate of the glass sample, and also, more ions are deposited on the quartz substrate than the glass. The EDX and UV-Visible spectroscopies were used for studying the penetration rate and the type of ions present on the substrates. The surface profilometer and scanning electron microscopy were used to investigate the profile and the width of the affected area. X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) was used to study the metal target's composition.

Keywords: Laser Backwriting, Laser ablation, Plasmon, Microchannel

Journal of Nuclear Science and Technology

Vol. 99, No 2, 2022, P 37-46



مجله علوم و فنون هستهای جلد ۹۹، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱، ص ۳۷–۴۶

۱. مقدمه

فرایند پشتنگاری لیزری^۱ (LBW) روشی برای ساخت موجبرهای نوری است که در سال ۲۰۰۶ م. مطرح شد [۱]. اگرچه روشهای مختلفی برای ساخت موجبرهای نوری وجود دارد، این روش بهدلیل هزینههای کمتر و سرعت بالاتر ساخت می تواند جایگزین مناسبی برای روشهای پیشین باشد [۲]. در این فرایند زیرلایه شفاف بر روی نمونه هدف قرار می گیرد و نور لیزر پس از عبور از عدسی استوانهای و قبل از رسیدن به نمونه از زیرلایه شفاف عبور می کند. نور با برخورد به نمونه باعث كندگى سطح آن مىشود. پلاسماى حاصل از كندگى وارد زیرلایه شده و در نقاطی که یونهای حاصل از کندگی جایگزین شبكه اتمها مىشوند باعث ايجاد تغييرات ضريب شكست و ایجاد ناحیه موجبری می شود [۳]. یکی از پارامترهای مهم در انتخاب زیرلایه، جذب پایین زیرلایه در طول موج لیزر است تا علاوه بر عدم جذب يرتوى ليزر توسط زيرلايه، تغيير ايجاد شده در زیرلایه تنها حاصل از پلاسمای نفوذ یافته در آن باشد. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده در این مقاله نشان میدهد که تحت شرایط تابشدهی مناسب، این روش میتواند برای ایجاد میکروکانالهایی با ابعاد کوچکتر از آنچه قابلدستیابی با استفاده از تابش و کندگی مستقیم لیزری است، مورد استفاده قرار گیرد. این مسأله قویاً به نوع زیرلایه و پارامترهای تابش بستگی دارد. در پژوهش حاضر تنها اثر فرایند LBW روی زيرلايهها بدون درنظر گرفتن ميزان تغيير ضريب شكست و ایجاد موجبر بررسی شده است. در جریان LBW دو فرایند پایه اتفاق می افتد که باعث ایجاد کانال در زیر لایه های شفاف می شود. این دو پدیده عبارتند از کندگی لیزری و برهم کنش پلاسمای حاصل از کندگی با زیرلایههای شفاف. در نتیجه ویژگی کانالهای ایجاد شده در زیرلایهها مانند پهنای کانالها و نوع و میزان یونهای نفوذ یافته داخل کانالها [۴، ۵] به مشخصهها و ساختار زیرلایههای شفاف، پارامترهای لیزر، ویژگیهای نمونه هدف مورد استفاده و همچنین رفتار دینامیکی پلوم پلاسما قبل از رسیدن به زیرلایهها [۶] وابسته است. در مقاله حاضر علاوه بر بررسی فرایند، تفاوت در تغییرات ایجاد شده در دو زیرلایه متفاوت بررسی شده است.

۲. چیدمان آزمایش شکل ۱ طرحی از چیدمان آزمایش را نشان میدهد. لام شیشهای و کوارتز بهعنوان زیرلایه استفاده شدهاند. ترکیب مولی

1. Laser Backwriting Process

مجله علوم و فنون هستهای جلد ۹۹، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱، ص ۳۷-۴۶

لام شیشهای شامل ۷۲٪ و کوارتز شامل ۹۹٪ از SiO_۲ است. یکی از ویژگیهای مهم زیرلایهها در فرایند LBW، نقطه نرمشوندگی بالا و ضریب انبساط گرمایی پایین است که هر دو زيرلايه مورد استفاده در اين پروژه بهدليل دارا بودن اين ویژگیها، نمونههای مناسبی جهت انجام فرایند هستند [۱]. فلز مورد استفاده در این پروژه استیل است که دارای رسانندگی گرمایی پایینی به مقدار ۱۴ W/m.k است. کانالهای ایجاد شده برروى زيرلايهها توسط ليزر Nd:YAG كيوسوئيچ شده با طول موج ۸ ns بهنای پالس ۸ ns و بیشینه انرژی پالس ۱۵۰ mJ در شاریدگیهای ۲٫۹ J/cm^۲ و ۲٫۷ J/cm^۲ و نرخ تكرار Hz و IHz و تعداد پالسهای مختلف تابشدهی شدهاند. از دو عدسی کروی بهعنوان پرتوگستر و یک عدسی استوانهای با فاصله کانونی ۱۰ cm برای تابش روی هدف استفاده شده است. شرایط آزمایشگاهی برای هر دو زیرلایه یکسان در نظر گرفته شده است تا تفاوت در نتایج تنها حاصل از تفاوت در ساختارهای این دو ماده مانند ترکیبات مولی آنها باشد.

۳. نتایج

۱.۳ زیرلایه کوارتز

۱.۱.۳ بررسی اثر شاریدگی و تعداد پالس بر عمق و پهنای کانالهای ایجاد شده روی کوارتز

شکلهای ۲ و ۳ بهترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی از کندگی ایجاد شده در کوارتز با نرخ تکرار ۲۸، ۶۰ پالس و شاریدگیهای مختلف، و شاریدگی ۲/۹ J/cm^۲ و تعداد پالس مختلف را نشان میدهند (تمامی تصاویر SEM در مقیاس ۱۰۰ μm ۱۰۰ اندازه گیری شدهاند). همان طور که مشخص است، یونهای حاصل از فرایند کندوپاش در اطراف کانال قابل مشاهده هستند و داخل کانال سطح صاف مشاهده می شود.

آينه Nd:YAG عدسی استوانه ای زيرلايه شفاف نمونه ی هدف فلزی

شکل ۱. طرحی از چیدمان آزمایش.





شکل ۲. تصاویر SEM از کندگی ایجاد شده برروی کوارتز با ۶۰ پالس، نرخ تکرار Hz ۱ و شاریدگی الف) ۲٫۹ J/cm^۲، ب) ۲٫۲cm^۲، ج) ۲٫۹ J/cm^۲.



شکل ۳. تصاویر SEM از کندگی ایجاد شده بر روی کوارتز با نرخ تکرار ۱ Hz، شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و الف) ۳۰، ب) ۶۰، ج) ۹۰ و د) ۱۲۰ پالس.

پلوم در فضای فلز و کوارتز طی یک فرایند دینامیکی گسترش مییابد و گرمای مرکز آن باعث پرتاب ذرات به سمت اطراف می شود. به دلیل این که پرتو لیزر گاوسی است، بیش ترین انرژی لیزر در مرکز پرتو است و دمای پلاسمای کنده شده در مرکز بیش تر خواهد بود؛ این دما و فشار مرکز پلوم باعث پرتاب مواد پلوم به سمت اطراف شده و پلوم گسترش مییابد. شکلهای ۴ و ۵ نمودار پروفایل کانالهای ایجاد شده تحت شرایط مختلف تابش دهی را نشان می دهد.

همان طور که از شکلها دیده می شود، مواد پرتاب شده از پلاسما به سمت كوارتز بهعنوان مواد باقىمانده كه طى فرايند کندوپاش و یا دیگر فرایندها ایجاد می شوند، یک محدوده ناصاف بالای سطح صیقل داده شده کوارتز ایجاد می کنند که دقیقاً در اطراف کانال قرار می گیرند؛ بنابراین در اطراف هر کانال، دو قله شامل مواد تهنشین شده مشاهده می شود. برای تعیین عمق كانال، عمق فاصله بين نقطه ارتفاع صفر و بيشترين عدد بهدست آمده برای ارتفاع منفی درنظر گرفته شده است. عمق در واقع برد یون هایی که باعث ایجاد فرایند کندوپاش شدهاند را نشان میدهد [۴]. در تعداد ۶۰ پالس و نرخ تکرار Hz ، میزان عمق برای کانالی با شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ بزرگتر از شاریدگی ۱٫۲ J/cm^۲ و کانالی با شاریدگی ۱٫۲ J/cm^۲ بزرگتر از کانالی با شاریدگی J/cm^۲ است. دلیل این امر را میتوان چنین بیان کرد که با افزایش شاریدگی از ۱٫۲ J/cm^۲ به ۲ J/cm افزایش دز انرژی رسیده به سطح، کندگی از سطح فلز افزایش می یابد. با افزایش عمق کندگی از سطح فلز بهدلیل این که یونها از فاصله دورتری نسبت به کوارتز، از سطح کنده شدهاند،

میکند. بهعبارت دیگر، در لحظهی شروع پلاسما دارای بیشینه بیشترین دما است و در نتیجه ذرات پلاسما دارای بیشینه سرعت و انرژی هستند. با گذشت زمان دمای پلاسما به شکل نمایی کاهش پیدا کرده و از اینرو سرعت و انرژی یونها کاهش مییابد؛ بنابراین هنگامی که یونها به سطح کوارتز میرسند، انرژی آنها به میزان زیادی کاهش یافته است. فرایند کندوپاش به میزان زیادی به سرعت یونهای برخوردی بستگی دارد. در سرعتهای پایین، فرایند کندگی از سطح کوارتز به میزان کمتری اتفاق میافتد و در سرعتهای بالا میزان کندگی افزایش پیدا میکند [۵].

انرژی و سرعت آنها هنگام برخورد با سطح کوارتز کاهش پیدا



شکل ۴. نمودار نمایه سطحی از سطح کوارتز پردازش شده با نرخ تکرار ثابت ۱ Hz ۱، تعداد پالس ثابت ۶۰ پالس و شاریدگیهای مختلف.



شکل ۵. نمودار نمایه سطحی از سطح کوارتز پردازش شده با نرخ تکرارثابت ۱ Hz و شاریدگی ثابت ۲٫۹ J/cm^۲ و تعداد پالسهای مختلف.

با افزایش شاریدگی از ۲ J/cm^۲ به ۲_/۹ J/cm^۲ میزان کندگی بیشتر میشود. بعد از شاریدگی ۲ J/cm^۲ پدیده پوشانندگی پلاسمایی مانع از رسیدن تمام پهنای پالس لیزر به سطح و در نتیجه کندگی می شود. از طرفی با شروع فرایند پوشش پلاسمایی انرژی لیزر توسط پلوم جذب شده و در نتیجه انرژی ذرات پلوم افزایش مییابد [۶]، پس ذرات پلوم با انرژی بیشتری به سطح کوارتز برخورد کرده و باعث افزایش کندوپاش و عمق کانال میشود. با افزایش تعداد پالس، دز انرژی ورودی به نمونه هدف افزایش یافته و کندگی افزایش مییابد. اما حجم کندگی و انرژی یونها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در شرایط مختلف این آزمایش، این عوامل با یکدیگر رقابت داشته و در نهایت یکی از عوامل غالب خواهد بود. در ۳۰ پالس، بهدلیل عمق کمتر کندگی از سطح استیل بعد از تعداد پالس مشخص، یونهای کندهشده از استیل در فاصله کمی نسبت به کوارتز قرار دارند، در نتیجه با وجود حجم پایین پلاسما، انرژی یونها هنگام برخورد به کوارتز بسیار زیاد است و همین باعث شده در این شرایط تابشدهی، بیشترین میزان کندوپاش از سطح کوارتز اتفاق افتد و بیشترین عمق کانال قابل مشاهده باشد. در ۶۰ پالس، حجم پلوم افزایش می یابد اما به دلیل فاصله زیاد پلوم از کوارتز، ذرات هنگام برخورد به کوارتز دارای انرژی پایینتری بوده و میزان کندوپاش کاهش می یابد. در ۹۰ و ۱۲۰ پالس با وجود افزایش تعداد پالس، بهدلیل پوشش پلاسمایی میزان کندگی از استیل، برهم کنش پلوم با کوارتز و کندوپاش کاهش می یابد.

۲.۱.۳ نتایج طیفسنجی جهت تعیین اثر تعداد پالس بر میزان نفوذ یونها در کوارتز و در نرخ تکرار Hz

برای بررسی اولیه نوع و میزان نفوذ یونها در زیرلایه، طیف جذبی نمونهها با طیفسنجی UV-Vis مورد مطالعه قرار گرفت. شکلهای ۶ الف و ۶ ب نمودار طیف جذبی نمونههای مختلف را نشان مىدھند.

همان طور که از شکل مشخص است، در نمونه های مربوط به ۶۰ پالس و بیشتر، دو قله جذبی وجود دارد. برای مشخص کردن علت ایجاد این قلهها، دانستن ترکیبات موجود در استیل ضروری است. بهمنظور شناسایی عناصر موجود در استیل موردنظر و بهدنبال آن شناسایی عناصر موجود در میکروکانالها که باعث ایجاد قلههای جذبی در نمودارها شده است، از آنالیز پرتو ایکس ^۱ (XRF) استفاده شده است. آنالیز پرتو ایکس نمونه استیل مورد استفاده شامل ۶۸٬۸۳٪ آلیاژ آهن، ۱۸٬۶۷٪ کروم، ۸٬۹۲٪ نیکل، ۱٬۳۲٪ منگنر، ۱٬۳۰٪ سیلیسیم و ۵۸٬۰۰٪ گوگرد است. بنابراین قابل انتظار است که یونهای نفوذیافته در

زيرلايهها آهن، كروم، نيكل، منگنر، سيليسيم و گوگرد باشد. قلههای موجود در طولموجهای ۲۹۱ nm و ۶۱۰ nm طیف کوارتز مربوط به پلاسمونهای ایجاد شده بهترتیب ناشی از حضور فلزات آهن [۷] و کروم [۸] در استیل است. جابهجایی پلاسمونی موجود در کروم مربوط به تغییرات ضریب شکست محيط اطراف آن بهعلت وجود آهن است [۹]. كندگي ليزري استیل (یا هر فلز دیگر) باعث ایجاد پلاسما می شود. این پلاسما حاوی ذرات باردار شامل یونها و الکترونهای آزاد است که امكان ایجاد پلاسمون را فراهم میكنند. تعدادی از این ذرات با توجه به انرژی و سرعت خود به داخل کوارتز نفوذ میکنند. تعداد ذرات کنده شده به پارامترهای لیزر بستگی دارد. همچنین ميزان نفوذ پلاسما به داخل كوارتز تحت تأثير نيروي جاذبه و دافعه بين ذرات باردار پلاسما خواهد بود. افزون براين، با افزايش تعداد پالس، علاوه بر افزایش تعداد ذرات کنده شده، عمق کندگی روی هدف (استیل) افزایش یافته و در نتیجه فاصله پلوم پلاسما از زیرلایه بیشتر می شود. بنابراین پارامترهای مختلفی در فرایند نفوذ به داخل کوار تز مؤثر هستند.



شکل ۶. طیف جذبی سطح کوارتز پردازش شده با شاریدگی الف) ۲ J/cm^۲، ب) ۲٫۹ J/cm^۲ و نرخ تکرار ۱ Hz.



^{1.} X-Ray Fluorescence Spectroscopy

در شکل ۶ الف، با افزایش تعداد پالس از ۳۰ به ۶۰، افزایش در میزان جذب و سپس با افزایش از ۶۰ به ۱۲۰، کاهش در میزان جذب مشاهده می شود. همان طور که در شکل دیده می شود، در ۶۰ پالس که بیش ترین میزان جذب اتفاق افتاده، پلاسمون های سطحی شکل گرفته و در ۹۰ و ۱۲۰ پالس نیز، هنوز پلاسمون های سطحی وجود دارد. در حالی که در ۳۰ پالس که جذب کمترین میزان خود را داشته است، پلاسمونهای سطحی شکل نگرفتهاند. در شکل ۶ ب با افزایش تعداد پالس از ۳۰ به ۹۰، افزایش در میزان جذب و با افزایش تعداد پالس از ۹۰ به ۱۲۰، کاهش در میزان جذب مشاهده می شود. مطابق شکل در این نمودار نیز در تعداد پالسهای ۹۰ و ۱۲۰، که بیشترین میزان جذب شکل گرفته، پلاسمونهای سطحی ایجاد شدهاند. قله جذبی کروم در طول موج حدود ۵۰۰ nm است، اما همان طور که در شکل ۶ مشاهده می شود، پلاسمون های کروم در حدود nm دارای قله می باشند. با توجه به این که با افزایش ضریب شکست و افزایش زبری محیط اطراف پلاسمون های سطحی، قله پلاسمون جابه جایی فرکانسی قرمز پیدا میکند [۱۰]، در نمونههای ایجاد شده بهدلیل این که در محيط اطراف كروم، يونهاي آهن به ميزان زيادي وجود داشته، باعث افزایش ضریب شکست و زبری اطراف کروم شده است و شیفت فرکانسی برای کروم مشاهده می شود. برای بررسی ذرات کنده شده از فلز و عناصر موجود روی زیرلایه، به ویژه لبههای کانالهای ایجاد شده، علاوه بر طیفسنجی از EDX استفاده شده است. شکل ۷ نمونهای از طیف ذرات تهنشین شده را نشان می دهد.

در طیف موجود چهار عنصر Cr ،Si ،O و Fe مشاهده می شود. این نتیجه برای تمام طیف ها مشاهده شده است. به منظور بررسی تفاوت میزان ذرات کنده شده از هدف و ته نشین شده روی زیر لایه، شدت عناصر مختلف در جدول ۱ گزارش شده است.



شکل ۷. نمودار EDX از سطح کوارتز پردازش شده با نرخ تکرار Hz ، شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و ۶۰ پالس. مجله علوم و فنون هستهای

۱۲	جدول ۱ . آنالیز EDX از لبههای کانالهای کوارتز با Hz ۱						
'∕.Fe	%.Cr	7.Si	Ϋ́. Ο	ترکیبات شاریدگی			
۲۵٫۲	۶,۴	۶٣,٣	۵,۱	۶۰) ۱٫۲ J/cm ^۲ پالس)			
۵۵	۶٫۰	۳۱٫۹	۲٫۵	۲ (۶۰ پالس) ۲ J/cm			
۲۳٫۳	۵٫۶	۶۵٬۵	۵,۶	۲٫۹ J/cm ^۲ (۶۰ پالس)			
$\Upsilon \Delta / A$	۶	۶۳٬۵	۴,۲	۳۰ پالس (۱ Hz)			
۲۳٫۳	۵٫۶	۶۵٬۵	۵,۶	۶۰ پالس (۱ Hz)			
11/1	٣,٣	۷۸٫۶	۶,٩	۹۰ پالس (۱ Hz)			
١٢,٢	۳,۶	$\mathbf{Y}\mathbf{A}_{I}\mathbf{Y}$	۶,۲	۱۲۰ پالس (۱ Hz)			

همانطور که از جدول ۱ مشخص است، آهن و کروم، که در استیل نیز به میزان بیشتری حضور دارند، در اطراف کانال مشاهده می شود. در بین عناصر استیل، تنها آهن و کروم از سطح آن کنده شده و به کوارتز برخورد کردهاند که با توجه به این که میزان آهن در استیل بیشتر است، در کوارتز نیز درصد آهن نفوذ یافته بیشتر است.

۲۰۳ اثر نرخ تکرار

شکل ۸ تصاویر SEM از سطح کوارتز پردازش شده با نرخ تکرار ۲۰۰ Hz، شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و تعداد پالس های مختلف را نشان می دهد. با توجه به نتایج شکل ۹، در ۳۰ پالس کم ترین عمق کانال و با توجه به نتایج SEM، کم ترین میزان ذرات در اطراف کانال وجود دارد. با این حال با توجه به نتایج طیف سنجی، بیش ترین میزان جذب در ۳۰ پالس است. بنابراین بیش تر ذراتی که از استیل به کوارتز برخورد کردهاند، به سطح زیر کوارتز نفوذ کرده و پلاسمون های سطحی ایجاد کردهاند.

شکل ۹ نمایه سطح کانالهای ایجاد شده روی کوارتز با شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و نرخ تکرار Hz ۱۰ ۲ را نشان می دهد. در شکل ۹ با افزایش تعداد پالس از ۳۰ به ۹۰، عمق کانال افزایش یافته و با افزایش از ۹۰ به ۱۲۰ پالس، کاهش پیدا کرده است. در این شرایط آزمایش به نظر می رسد بعد از ۳۰ پالس پدیده پوشانندگی پلاسمایی اتفاق افتاده است و در نتیجه در ۹۰ پالس به سطح کوارتز برخورد کردهاند، انتظار می رود با کاهش انرژی یونها فرایند کندوپاش در سطح کوارتز کاهش یابد. اما به دلیل این که در پدیده پوشانندگی انرژی لیزر توسط پلوم جذب شده ذرات با انرژی بیش تری به کوارتز برخورد کرده و در نتیجه کندوپاش از کوارتز افزایش یافته است. پس در ۹۰ پالس هم تعداد یون رسیده به سطح کوارتز افزایش یافته و

Journal of Nuclear Science and Technology

Vol. 99, No 2, 2022, P 37-46



شده در نتیجه عمق کندوپاش از کوارتز افزایش یافته است. در ۱۲۰ با افزایش عمق، تعدادی از ذرات کنده شده بهدلیل انرژی پایین قادر به رسیدن به سطح زیرلایه نبوده و نیز پوشانندگی پلاسما افزایش بیشتری یافته و مانع رسیدن پرتو به فلز و کندگی بیشتر میشود پس انرژی یونها کاهش یافته و باعث کمتر شدن کندوپاش در ۱۲۰ پالس شده است.

در شکل ۱۰ الف با افزایش از ۳۰ به ۶۰ پالس، کاهش در جذب و با افزایش از ۶۰ به ۱۲۰ پالس، افزایش در جذب مشاهده میشود. در این نمودار فقط در تعداد پالسی که کمترین میزان جذب وجود دارد، پلاسمونهای سطحی شکل نگرفتهاند و در بقیه تعداد پالسها پلاسمونها قابل مشاهده هستند. در نمودار شکل ۱۰ ب با افزایش از ۳۰ به ۶۰ پالس کاهش جذب و از ۶۰ به ۱۲۰ پالس افزایش در میزان جذب مشاهده میشود. در این نمودار در تعداد ۳۰ پالس که بیشترین میزان جذب اتفاق افتاده است، پلاسمونها قابل مشاهده هستند. در ۶۰ و ۹۰ پالس که کمترین میزان جذب اتفاق افتاده است، پلاسمونها وجود نداشته و در تعداد ۱۲۰ پالس دوباره پلاسمونهای سطحی مشاهده میشوند.



شکل ۸. تصاویر SEM از نمونهی ایجاد شده بر روی کوارتز با نرخ تکرار ۱۰ Hz، شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲، الف) ۳۰، ب) ۶۰، ج) ۹۰ و د) ۱۲۰ پالس.



شکل ۹. نمودار نمایه سطحی از سطح کوارتز پردازش شده با نرخ تکرار ثابت ۱۰ Hz و شاریدگی ثابت ۲_/۹ J/cm^{2۲}.



شکل ۱۰. نمودار طیف جذبی سطح کوارتز پردازششده با شاریدگی الف) ۲/۹ J/cm^۲ ۲ ب) ۲/۹ J/cm^۲ و نرخ تکرار ۱۰ Hz.

جدول ۲ شدت عناصر تهنشینشده روی کوارتز در نرخ تکرار ۱۰Hz و شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ در تعداد پالس متفاوت را نشان میدهد. با افزایش از ۶۰ به ۹۰ پالس فرایند کندوپاش افزایش یافته و همچنین طبق نتایج پروفایل سنجی در ۹۰ پالس بیش ترین عمق کانال مشاهده می شود. طبق نتایج طیف سنجی، میزان جذب در ۹۰ پالس نسبت به ۶۰ پالس افزایش داشته است. با افزایش تعداد پالس از ۹۰ به ۱۲۰ پالس، میزان یون هایی که در فرایند کندوپاش شرکت کرده اند به میزان اندکی کاهش یافته است.

۳.۳ زیرلایه شیشه

۱.۳.۳ بررسی اثر شاریدگی و تعداد پالس بر عمق و پهنای کانالهای ایجاد شده روی شیشه شکلهای ۱۱و ۱۲ تصاویر کانال برروی شیشه با نرخ تکرار Hz و تحت شرایط مختلف تابشدهی را نشان میدهند.

جدول ۲. آنالیز EDX از لبههای کانالهای کوارتز با Hz ا						
%.Cr	7.Si	7. O	ترکیبات شاریدگی			
٣٫٩	٧۶٬۵	$\Delta_{/}A$	۳۰ پالس (۱۰ Hz)			
۶٫۵	۵۹٫۷	۵,۱	۶۰ پالس (۱۰ Hz)			
۶٫٩	۵۷	۴٫۵	۹۰ پالس (۱۰ Hz)			
٣,۶	۲۸,۱	۶,۲	۱۲۰ پالس (۱۰ Hz)			
	کوارتز با Iz. Cr/? ۶٫۵ ۶٫۹ ۳٫۶	Hz کانالهای کوار تز با Cr ٪.Si ۳٫۹ ۷۶٫۵ ۶٫۵ ۵۹٫۷ ۶٫۹ ۵۷ ۳٫۶ ۷۸٫۱	Hz از لبههای کانالهای کوار تز با E ۲/Cr ٪.Si ٪.O ۳/٩ ٧۶/۵ ۵/٨ ۶/۵ ۵۹/٧ ۵/۱ ۶/٩ ۵۷ ۴/۵ ۳/۶ ۷۸/۱ ۶/۲			



شکل ۱۱. تصاویر SEM از سطح شیشه پردازش شده با نرخ تکرار ۱Hz ، ۶۰ یالس و شاریدگی الف) ۲ J/cm^۲ ، ب) ۲ J/cm^۲ و ج) ۲ ۲



شکل ۱۲. تصاویر SEM از سطح شیشه پردازش شده با نرخ تکرار Hz ، شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و الف) ۳۰، ب) ۶۰، ج) ۹۰ و د) ۱۲۰ پالس.

همان طور که از تصاویر SEM مشخص است، در ۳۰ پالس، نرخ تکرار ۱ Hz و شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ میزان یونهایی که در فرايند كندوپاش شركت كردهاند، بسيار ناچيز است. با افزايش تعداد پالس از ۳۰ به ۶۰، میزان یونهای اطراف کانال افزایش می یابد. هم چنین از جدول ۳ مشخص است که در شاریدگی ۲ J/cm^۲ بیشترین میزان جذب یون در اطراف کانال قابل مشاهده است و با توجه به نمودارهای طیف جذبی مربوط به شیشه که در ادامه گزارش شده، این نتیجه تأیید می شود. میتوان نتیجه گرفت در شاریدگی ۲ J/cm^۲ بیشترین میزان کندگی از استیل اتفاق افتاده است که هم در شیشه و هم در کوارتز در این شاریدگی میزان جذب یون به میزان قابلملاحظهای افزایش یافته است. بهنظر میرسد در شاریدگی ۲ J/cm^۲ بیشترین حجم پلاسما و انرژی ذرات وجود داشته است. با افزایش تعداد پالس از ۶۰ به ۹۰ تقریباً میزان یونهای اطراف کانال ثابت بوده و تغییر قابلملاحظهای وجود ندارد. در ۱۲۰ پالس، بیشترین میزان یون در اطراف کانال قابل مشاهده است.

شکل ۱۳ نمودار نوعی EDX از عناصر موجود در اطراف کانال ایجاد شده بر روی شیشه با نرخ تکرار Hz ، ۶۰ پالس و شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ را نشان میدهد.

١Η	جدول ۳ . آنالیز EDX از لبههای کانالهای شیشه با Hz ۱				
7.Fe	7.Si	% O	تركيبات شاريدگی		
۱۷٫۲	۶۷٫۳	$\Delta_{/\Delta}$	۶۰) ۱٫۲ J/cm ^۲ (۶۰ پالس)		
$\Delta \cdot \Delta_{/}$	٣٩٫۵	٩٫٩	۶۰) ۲ J/cm ^۲ (۶۰ پالس)		
۱۵,۹	۵۲,۰	۳۲,۱	۶۰) ۲٫۹ J/cm ^۲ (۶۰ پالس)		
۲,٧	ΔY_{I}	۴.,۲	۳۰ پالس (۱ Hz)		
۱۵,۹	۵۲,۰	۳۲,۱	۶۰ پالس (۱ Hz)		
Δ_{1}	۶۰,۸	24/1	۹۰ پالس (۱ Hz)		
۶۰,۷	۲۷٫۸	۱۱٫۵	۱۲۰ پالس (۱ Hz)		



شکل ۱۳. نمودار EDX و درصد عناصر موجود در اطراف کانال ایجاد شده بر روی شیشه با نرخ تکرار ۲، ۲، ۶۰ پالس و شاریدگی ۲،۹ J/cm^۲.

۲.۳.۳ مشاهدات طیفسنجی جهت تعیین اثر تعداد پالس بر میزان نفوذ یونها در شیشه و در نرخ تکرار HZ

شکل ۱۴ طیف سطح شیشه پردازش شده در تعداد پالس و شاریدگیهای مختلف و در نرخ تکرار ۱ Hz را نشان میدهد.

همان طور که مشخص است طیف شیشه خام در ناحیه مرئی دارای جذب نمی باشد ولی در ناحیه فرابفنش جذب بالایی دارد، بهطوریکه برای طول موجهای کمتر از ۳۰۰ nm به اشباع رسیده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود، در تمامی نمونههای تابش دیده، قله جذبی در طول موج ۲۹۱ nm مربوط به یونهای آهن وجود دارد [۱۱]. همچنین در شاریدگی و پالسهای مختلف، طیفها تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند. این پدیده با توجه به بالا بودن شدت جذب در شیشه، نشاندهنده به اشباع رسیدن فرایند نفوذ است. این نتیجه برای تمام شاریدگیهای مورد آزمایش برقرار است.

۴.۳ اثر نرخ تکرار

در شکل ۱۵ تصاویر SEM مربوط به کانالهای ایجاد شده روی شیشه با نرخ تکرار ۱۰ Hz و شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و تعداد



پالس مختلف و در جدول ۴ آنالیز EDX از لبههای کانال مشاهده میشود. همانطور که مشخص است، با افزایش نرخ تکرار نیز میزان یونهای موجود در اطراف کانال بسیار ناچیز است.

همان طور که از شکل ۱۶ مشخص است، در نرخ تکرار ۱۰ Hz نیز همانند نرخ تکرار ۱ Hz، نمودارها در شاریدگی و پالسهای مختلف بر یک دیگر منطبق هستند.



شکل ۱۴. نمودار طیف جذبی سطح شیشه پردازش شده با شاریدگی ۱٫۲ J/cm^۲ و نرخ تکرار ۱ Hz .



شکل ۱۵. تصاویر SEM از سطح شیشه پردازش شده با نرخ تکرار Hz و شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و الف) ۳۰، ب) ۶۰، ج) ۹۰ و د) ۱۲۰ پالس.



شکل ۱۶. نمودار طیف جذبی سطح شیشه پردازش شده با شاریدگی ۱٫۲ J/cm^۲ و نرخ تکرار ۱۰ Hz.



جدول ۴. آنالیز EDX از لبههای کانالهای شیشه شاریدگی ۲٫۹ J/cm^۲ و نرخ تکرار با ۱۰ Hz

%.Fe	7.Si	'/.O	ترکیبات شاریدگی
٩٫۵	۶، ۲۰ ا	۱۹٫۹	۳۰ پالس (۱۰ Hz)
۱۵,۲	۶۱	۲۳٫۸	۶۰ پالس (۱۰ Hz)
۱۶,۱	۵۳٫۲	۳۰,۷	۹۰ پالس (۱۰ Hz)
٣۴,٢	۳۵٫۷	٣٠٫١	۱۲۰ پالس (۱۰ Hz)

۴. بحث و مقایسه نتایج در شیشه و کوارتز

در لیزرهای نانوثانیه فرایند کندگی از فلز با تغییر فاز از حالت جامد به مایع، از مایع به بخار و در صورت بالا بودن شار لیزری، از فاز بخار به پلاسما صورت می پذیرد. فرایند کندگی وابسته به ویژگیهای اپتیکی و حرارتی فلز و پارامترهای لیزر است. قسمتی از انرژی لیزر که جذب سطح شده صرف تبخیر ماده می شود و بخشی از آن از طریق رسانش گرمایی در ماده انتشار می یابد. وابستگی عمق حفره ایجاد شده به شاریدگی از طریق تقسیم انرژی بین فازهای جامد و گاز تعیین می شود. سازوکار خروج جرم از حفره نیز به شاریدگی لیزر وابسته است [۱۲]. در فلز استیل گرمای نهان تبخیر نسبت به گرمای نهان ذوب بیشتر است در نتیجه هنگامی که پالس لیزری به استیل مى تابد، با گذشت زمان اختلاف فاز مايع- جامد كم و اختلاف فاز مایع- بخار زیاد می شود. در نتیجه در یک نقطه مشخص شرایط به گونهای خواهد بود که ضخامت بین فاز بخار و مایع بسیار کم شده و به صفر میل میکند. در این لحظه چون ماده مذاب بسیار کم است، سطح نیازمند میزان کمی افزایش انرژی است تا دوباره ضخامت فاز مايع و بخار زياد شده و فرايند توليد پلاسما با انرژی کمی بیشتر ادامه پیدا کند. انتظار میرود میزان تولید پلاسما در لحظه اول کم باشد و سپس با گذشت زمان، پلاسمای بیشتری تولید شده و در لحظات بعدی به شکل نمایی کاهش یابد. این روند یک روند افزایش- کاهشی تکرارپذیر است. شکل ۱۷ نمودار انرژی لیزر که بر حسب زمان در پلوم قرار گرفته است را نشان میدهد. با افزایش شاریدگی در هر لحظه، انرژی پلوم افزایش پیدا کرده است. با گذشت زمان، انرژی پلوم کاهش پیدا کرده و بعد از چند نانوثانیه، افزایش کوچکی در انرژی مشاهده می شود و تکرار این روند قابل مشاهده است.



مجله علوم و فنون هستهای



شکل ۱۷. نمودار انرژی پلوم برحسب زمان براساس شاریدگی لیزر [۱۲].

بنابر تحلیلهای بیان شده منطقی به نظر میرسد که با افزایش شاریدگی از ۲ J/cm^۲ به ۲ J/cm ۲ و از ۲ J/cm^۲ به ۲/۹ J/cm^۲، بهدلیل افزایش انرژی وارد شده به استیل و با دور شدن نقطه کندگی از سطح استیل که باعث افزایش زمان حرکت پلاسما در فضا میشود، روند افزایشی و کاهشی در میزان مواد موجود در اطراف کانال دیده شود. در نتیجه در شاریدگی J/cm^۲ بیشترین میزان عناصر در اطراف کانال قرار میگیرد.

یکی دیگر از تفاوتهایی که در زیرلایههای شیشه و کوارتز وجود دارد، حضور یون Cr درکانالهای کوارتز است. در کوارتز يونهای آهن و کروم نفوذ کردهاند و قله پلاسمونی يونهای کروم جابهجایی پیدا کرده است که دلیل آن تغییر در غلظت ذرات دیالکتریک است [۹]. گرچه زیرلایه شیشه بهدلیل دارا بودن ۷۲٪ از SiO_۲ در ساختار خود، نسبت به کوارتز بستر مناسب تری برای نفوذ مواد به شمار میرود، اما یون Cr توانایی نفوذ به شیشه را در این آزمایش نداشته است. بنابراین دلیل این یدیده وابسته به رفتار دینامیکی پلاسما قبل از برخورد با زیرلایهها است. پلاسما شامل یونهای مثبت Fe و Cr است که از نمونه استیل کنده شدهاند. یونهای Fe بهدلیل بیشتر بودن وزن خود در محور مرکزی پلوم قرار می گیرند و یون های Cr بهدلیل وزن کمتر، در نقاط دورتر از محور مرکزی قرار می گیرند. علاوه بر این با توجه به آنالیز XRF از استیل یونهای Fe درصد بیشتری نسبت به یونهای Cr دارد و در پلوم باعث دفع یونهای کروم به سمت اطراف می شوند. پلوم قبل از رسیدن به شیشه فرصت کمتری برای گسترش در فضا دارد و در نتیجه چگالی آن بسیار بالاست. یونهای آهن بهدلیل نزدیکی بیشتر

به یونهای کروم باعث دفع آنها میشوند؛ در نتیجه به یونهای کروم اجازه قرارگیری در زیرلایه شیشه را نمیدهند. درحالیکه در کوارتز بهدلیل کندگی بیشتر پلوم فاصله بیشتری را طی میکند و در نتیجه بیشتر در فضا گسترش پیدا میکند. طی این گستردگی ذرات پلوم از هم دورتر میشوند و نیروی دافعه بین یونهای آهن و کروم کاهش مییابد. بنابراین هر دو یون به سطح کوارتز رسیده و در آن نفوذ میکنند.

۵. نتیجهگیری

در این پژوهش فرایند LBW روی شیشه و کوارتز در شرایط یکسان آزمایش و پارامترهای مختلف لیزر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از ایجاد میکروکانالها در زیرلایهها با قابلیت کنترل ابعاد و حضور نانوذرات در اطراف آنهاست. در زیرلایه کوارتز پلاسمونهای Fe و Cr و در زیرلایه شیشه ذرات Fe قابلمشاهده است. نتایج نشان میدهند پهنای محدوده تحت تأثیر پلوم پلاسما در زیرلایهها (پهنای کانالهای ایجاد شده در زیرلایهها) و نوع یونهای نفوذیافته در آنها به ویژگیهای حرارتی فلز، پارامترهای لیزر و رفتار دینامیکی پلوم پلاسما قبل از برخورد با زیرلایه وابسته است.

مراجع

- C. Gómez-Reino, Laser backwriting process on glass via ablation of metal targets, Opt. Commun., 273 (1), 193–199 (2007).
- R. Rangel-Rojo, et al, Waveguide formation by laser backwriting ablation of metals unto glass substrates, AIP Conf. Proc., 992, 231–236 (2008).
- C.I. López-Gascón, et al, *Refractive index* modification in glass by laser backwriting ablation of metals, Opt. Express, 14 (19), 8765 (2006).
- 4. Z.H.A.O. Yunfei, *Glass waveguide fabrication by ion implantation for optical communication applications*, (2000).
- 5. F.F. Umarov, A.A. Dzhurakhalov, *Ion bombardment-induced surface effects in materials*, IntechOpen, 359e391 (2016).
- 6. J.A. Aguilera, C. Aragon, F. Penalba, *Plasma* shielding effect in laser ablation of metallic samples and its influence on LIBS analysis, Aplied Surface Science, 309–314 (1998).
- K. Klačanová, Formation of Fe (0)-nanoparticles via reduction of Fe (II) compounds by amino acids and their subsequent oxidation to iron oxides. Journal of Chemistry, (2013).



- 8. P.T. Mohite, A.R. Kumar, S.S Zinjarde, Biotransformation of hexavalent chromium into extracellular chromium (III) oxide nanoparticles using Schwanniomyces occidentalis, Biotechnology letters, **38(3)**, 441-446 (2016).
- K. Shrivas, Localized surface plasmon resonance of silver nanoparticles for sensitive colorimetric detection of chromium in surface water, industrial waste water and vegetable samples, Analytical Methods, 8(9), 2088-2096 (2016).
- 10. V.N. Rai, et al, Localized surface plasmon resonance (LSPR) and refractive index sensitivity of vacuum evaporated nanostructured gold thin films, arXiv preprint arXiv:1406.4605 (2014).
- 11. M. Balcerzak, A. Tyburska, E.L.B.C.W.I.Ê. Cickafüchsel, Selective determination of Fe (III) in Fe (II) samples by UV-spectrophotometry with the aid of quercetin and morin, Acta Pharm, **58**, 327–334, (2008).
- 12. S. Mahmood, et al, Effects of laser energy fluence on the onset and growth of the Rayleigh – Taylor instabilities and its influence on the topography of the Fe thin film grown in pulsed laser deposition facility Effects of laser energy fluence on the onset and growth of the Rayleigh – Taylor instabilities and its influence on the topography of the Fe thin film grown in pulsed laser deposition facility, AIP Publishing LLC, **103504**, (2012).



استناد به این مقاله

شبنم عباسی، داود رزاقی، هدیه پازکیان (۱۴۰۱)، مقایسه فرایند پشتنگاری لیزری در زیرلایههای شفاف شیشه و کوارتز، ۹۹، ۳۷-۴۶

DOR: 20.1001.1.17351871.1401.43.1.5.8 **Url:** https://jonsat.nstri.ir/article_1348.html



مجله علوم و فنون هستهای جلد ۹۹، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱، ص ۳۷-۴۶